

第 79 回中国四国産学連携化学フォーラム

開催概要

主 催： 中国四国・化学と工業懇話会 日本化学会中国四国支部

共 催： 日本化学会

会 期： 7 月 11 日(金) 13 時～17 時 30 分

開催方式：ハイブリッド(～16:50 まで。以降は対面のみ)

会 場： 広島大学ミライクリエ 1F 多目的スペース

参加費： 無料

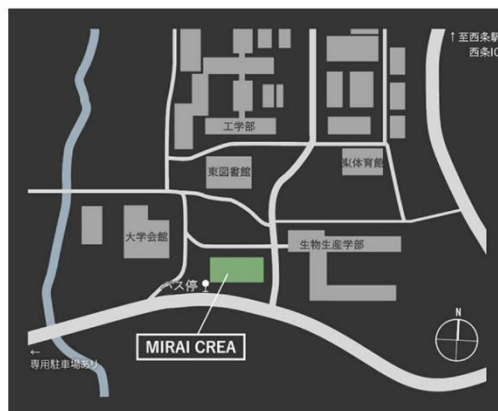
下記のフォームから事前申し込みをお願い致します。(締切 7/11, 懇親会参加締切 7/7)

申し込みサイトはこちらをクリック (URL: <https://forms.office.com/r/kpx5U8iFTT>)

13:00～13:05	開会の挨拶
13:05～13:40	【招待講演】 「意外と身近な『フェライト』とは？」 北村直行 (JFE フェライト株式会社)
13:40～14:15	【招待講演】 「ペロブスカイト型強誘電体における動的構造物性研究」 塚田真也 (島根大院教育)
14:15～14:25	企業紹介① 東ソー株式会社
14:25～14:40	【学生招待講演】 「イオン包接能を有するポリオキシメタレートの開発」 飼鳥弘人, 西原禎文, (広島大院先進理工, D2)
14:40～14:55	【学生招待講演】 「有機溶媒に可溶な分子状アルミナクラスターの合成と触媒特性」 馬越彩乃 (広島大院先進理工, D2)
14:55～15:05	企業紹介② 株式会社トクヤマ
15:05～15:20	(休憩)
15:20～15:30	企業紹介③ 株式会社ダイセル
15:30～15:45	【学生招待講演】 「金属フリーペロブスカイト結晶における固溶化手法の探究」 森口順平, 鈴木敦子, 綱島亮 (山口大院創成科学, D2)
15:45～16:00	【学生招待講演】 「単分子で強誘電性を示す単分子誘電体のデバイス実装」 有馬將稀, 西原禎文 (広島大院先進理工, D1)
16:00～16:10	企業紹介④ マナック株式会社
16:10～16:45	【招待講演】 「有機結晶における固溶体設計と物性制御への展望」 綱島亮 (山口大院創成科学)
16:45～17:20	【招待講演】 「Enabling the future: The Science of Photolithography and DRAM scaling」 宮原悠輔 (マイクロンメモリジャパン)
17:20～17:25	閉会の挨拶
18:00～20:00	懇親会

開催場所： 広島大学ミライクリエ1F 多目的スペース
東広島市鏡山一丁目 4-5

ACCESS



所在地：東広島市鏡山一丁目4番5号（東広島キャンパス南側）

TEL：082-424-8920

開館時間：8:00～20:00（日祝、年末年始を除く）



懇親会ご案内

フォーラム終了後、広島大学内、北1食堂にて懇親会を開催致します。お誘い合わせの上、奮ってご参加下さい。

場所： 広島大学北一食堂3F

時間： 18:00～20:30

懇親会費： 学生： ¥500、一般:¥4,000

懇親会は事前申し込み(懇親会の参加申し込み締切は 7/7 となっております。

